

Qufab装置利用単価表

2026年3月13日

装置番号	施設名称	設置場所	装置分類	共用施設等 使用料	技術代行費	技術指導費
				(円/時間)	(円/時間)	(円/時間)
Qufab001	i線ステッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィ装置	56,640	7,400	15,000
Qufab002	インライン型コータディベロッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィ装置	56,640	7,400	15,000
Qufab003	セミオートディベロッパー	CR1 イエロールーム	リソグラフィ装置	38,640	7,400	15,000
Qufab004	ウエハー洗浄装置	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	49,440	7,400	15,000
Qufab005	有機洗浄装置A	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	42,240	7,400	15,000
Qufab006	有機洗浄装置B	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	42,240	7,400	15,000
Qufab007	Nb-AIジョセフソン接合作製装置 [In-situ 分析器 & オゾン酸化器付]	CR2 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab008	Nb-AIジョセフソン接合作製装置 [標準型]	CR2 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab009	NbNジョセフソン素子作製装置	CR2 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab010	マルチターゲット（六源）スパッタ装置	4-9棟クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab011	絶縁膜作製装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab012	TEOS-CVD A	CR3 クリーンルーム	成膜装置	56,640	7,400	15,000
Qufab013	反応性イオンエッチング装置Samco-II	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	45,840	7,400	15,000
Qufab014	反応性イオンエッチング装置Samco-III	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	38,640	7,400	15,000
Qufab015	反応性イオンエッチング装置(Ulvac)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	45,840	7,400	15,000
Qufab016	ICP型反応性イオンエッチング装置 (Ulvac)	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	45,840	7,400	15,000
Qufab017	イオンミリング装置	CR3 クリーンルーム	エッチング装置	42,240	7,400	15,000
Qufab018	酸系ウェットエッチング装置	CR1 イエロールーム	エッチング装置	38,640	7,400	15,000
Qufab019	マニュアルプローバ	CR3 クリーンルーム	測定装置	31,440	7,400	15,000
Qufab020	シート抵抗測定装置	CR3 クリーンルーム	測定装置	31,440	7,400	15,000
Qufab021	ナノサーチ顕微鏡	CR3 クリーンルーム	測定装置	45,840	7,400	15,000
Qufab022	レーザ顕微鏡	CR1 イエロールーム	測定装置	45,840	7,400	15,000
Qufab023	段差計	CR3 クリーンルーム	測定装置	31,440	7,400	15,000
Qufab024	CMP1	CR3 クリーンルーム	表面処理装置	49,440	7,400	15,000
Qufab025	CMP2	CR7 クリーンルーム	表面処理装置	38,640	7,400	15,000
Qufab026	有機ドラフトチャンバー	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	3,600	7,400	15,000
Qufab027	無機ドラフトチャンバー	CR1 イエロールーム	ウェット処理装置	3,600	7,400	15,000
Qufab028	光学顕微鏡	CR1 イエロールーム	測定装置	600	7,400	15,000
Qufab029	ICP型反応性イオンエッチング装置（フッ素系）	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	45,840	7,400	15,000
Qufab030	ICP型反応性イオンエッチング装置（塩素系）	CR2 クリーンルーム	エッチング装置	49,440	7,400	15,000
Qufab031	光学膜厚計	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,600	7,400	15,000
Qufab032	顕微分光光学膜厚計	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,600	7,400	15,000
Qufab033	クラスタースパッタ装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab034	アッシング装置	CR5 クリーンルーム	エッチング装置	45,840	7,400	15,000
Qufab035	ALD装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab036	斜め蒸着装置	CR5 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab037	走査電子顕微鏡	CR5 クリーンルーム	測定装置	45,840	7,400	15,000
Qufab038	デバイス評価装置	1136室実験室	測定装置	45,840	7,400	15,000

Qufab039	シリコン深堀エッチング装置A	CR7 クリーンルーム	エッチング装置	45,840	7,400	15,000
Qufab040	シリコン深堀エッチング装置B	CR7 クリーンルーム	エッチング装置	45,840	7,400	15,000
Qufab041	パンプ形成用成膜装置	CR9 クリーンルーム	成膜装置	45,840	7,400	15,000
Qufab042	フリップチップボンダー	CR8 クリーンルーム	表面処理装置	45,840	7,400	15,000
Qufab043	有機洗浄装置C	CR3 クリーンルーム	ウェット処理装置	56,640	7,400	15,000
Qufab044	TEOS-CVD B	CR3 クリーンルーム	成膜装置	56,640	7,400	15,000
Qufab045	希釈冷凍機計測システム3	2-11B棟 011222室	測定装置	10,600	7,400	15,000
Qufab046	ウェハー表面検査装置	CR1 イエロールーム	測定装置	45,840	7,400	15,000
Qufab047	卓上型マスクレス露光装置	CR1 イエロールーム	リソグラフィー装置	38,640	7,400	15,000
Qufab048	4元スパッタ装置	CR3 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab049	光学膜厚計2	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,600	7,400	15,000
Qufab050	光学膜厚計3	CR3 クリーンルーム	測定装置	3,600	7,400	15,000
Qufab051	金属製膜用電子ビーム蒸着装置	CR4 クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab052	超伝導量子デバイス用スパッタリング装置	2-6棟クリーンルーム	成膜装置	53,040	7,400	15,000
Qufab053	超伝導薄膜材料評価蛍光X線分析装置	2-6棟クリーンルーム	測定装置	38,640	7,400	15,000
Qufab054	超伝導薄膜材料評価X線回折装置	2-6棟クリーンルーム	測定装置	38,640	7,400	15,000
Qufab055	走査型電子顕微鏡2	2-6棟クリーンルーム	測定装置	45,840	7,400	15,000
Qufab056	オートワイヤーボンダー	2-11B棟 測定室	測定装置	31,440	7,400	15,000
Qufab057	応力評価装置	CR4 クリーンルーム	測定装置	31,440	7,400	15,000

※この単価表に記載した金額に消費税等は含まれておりません。

※利用方法により下記の通りの課金額となります。

【装置利用】共用施設等使用料

【技術代行】共用施設等使用料＋技術代行費

【技術指導付き技術代行】共用施設等使用料＋技術代行費＋技術指導費

Qufabが提供している標準プロセスを利用する場合、各装置の1工程あたりの利用時間は標準利用時間で課金させていただきます、技術指導費は1工程あたり0.25時間課金させていただきます。

※ユーザーのご所属により、課金額に下記の係数がかかります。

大学、公的研究機関 0.5

海外機関 2

上記に該当しない場合は 1

※別途、課金額に下記の一般管理費がかかります。

国内機関 15%

海外機関 50%

詳しくはQufab事務局にお問い合わせください。